

## **Seminario sobre el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales**

**Ginebra, 8 de noviembre de 2012**

PROGRAMA PROVISIONAL

*preparado por la Secretaría*

- 9.00 – 9.30 Inscripción
- 9.30 – 9.45 Discurso de bienvenida pronunciado por:  
  
Sr. Yves Closet, Jefe de la Sección de Información y Promoción, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra
- 9.45 – 10.15 **Panorama General del Sistema de La Haya**  
  
Objetivos y características del Sistema de La Haya  
El Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya y acontecimientos recientes  
  
Oradora: Sra. Päivi Lähdesmäki, Jefa de la Sección Jurídica, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, OMPI
- 10.15 – 11.00 **Presentación de una Solicitud Internacional**  
  
Derecho a presentar una solicitud internacional  
Idiomas  
Representación ante la Oficina Internacional de la OMPI  
  
Oradora: Sra. Sandrine Pitaccolo, Sección Jurídica, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, OMPI
- 11.00 – 11.15 Pausa para el café
- 11.15 – 12.30 **La Solicitud Internacional y el Proceso de Examen**  
  
Presentación electrónica de solicitudes internacionales (*E-filing*)  
Contenido de una solicitud internacional electrónica  
Reproducciones de dibujos y modelos industriales  
Examen de una solicitud por la Oficina Internacional de la OMPI  
Irregularidades  
  
Orador: Sr. Patrick Cartant, Jefe del Servicio de Operaciones, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, OMPI
- 12.30 – 14.00 Almuerzo
- 14.00 – 14.45 **Registro Internacional**  
  
Publicación y aplazamiento de la publicación  
Posibilidad de denegación  
Efectos del registro internacional  
  
Orador: Sr. Hiroshi Okutomi, Jurista de la Sección Jurídica, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, OMPI

